SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent number:

JP2000020665

Publication date:

2000-01-21

Inventor:

WATANABE SHIGEYOSHI; NAGAOKA MASAMI;

KAMEYAMA ATSUSHI; YOSHIHARA KUNIO

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G06K19/07; G06K19/077; G08B13/24; H04B5/02; **G06K19/07; G06K19/077; G08B13/24;** H04B5/02; (IPC1-7): H04B5/02; G06K19/07; G06K19/077;

G08B13/24

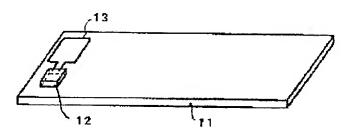
- european:

Application number: JP19980199535 19980630 Priority number(s): JP19980199535 19980630

Report a data error here

Abstract of JP2000020665

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device which is freely deformable, can be attached to merchandise of an arbitrary shape, is low in unit cost, does not require recovery after use and can prevent the erroneous operation of a circuit. SOLUTION: An LSI chip 12 formed into a thin film silicon and an antenna 13, which is formed of a vapor-deposited metal film and is connected to the LSI chip 12, are formed on a flexible film 11. When the antenna 13 receives electromagnetic waves, an electromotive force is generated by an electromagnetic induction, then the LSI chip 12 operates by being supplied with the force, and transmits the data held inside by way of the antenna 13. When the LSI chip 12 has not only a transmission circuit but also a reception circuit and a signal processing circuit, it is possible to receive a signal and process it by way of the antenna 13 and to transmits the signal in accordance with the result. Thus, the LSI chip 12, consisting of the film silicon and the antenna 13 consisting of the vapor deposited metal film, are formed on the flexible film 11, the device can be freely deformed and transformation is performed freely, and the film 11 can be affixed on a attached to merchandise of various shapes. and also made low in cost and reduced in power consumption.



Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000—20665

(P2000-20665A) (43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

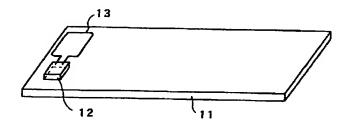
(51) Int. C1. 7 G06K 19/07 19/077	識別記号	F I G06K 19/00 G08B 13/24		Н	₹-₹3 5B035 5C084	コート' (参考)
G08B 13/24 // H04B 5/02		H04B 5/02 G06K 19/00		K	5K012	
				請求項の数4	FD	(全8頁)
(21)出願番号	特願平10-199535	(71)出願人	0000030	-		
(22) 出願日	平成10年6月30日(1998.6.30)	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 渡 辺 重 佳 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会 社東芝研究開発センター内				
		(72)発明者	神奈川県	正 見 川崎市幸区小向 宍開発センター		株式会
		(74)代理人		35 佐藤 一雄 ((外3名)	
			最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】半導体装置

(57)【要約】

【課題】 変形自在で任意の形状の商品に取り付けが可能で、単価が安く使用後の回収を不要とし、さらに回路の誤動作の防止が可能な半導体装置を提供する。

【解決手段】 可撓性フィルム11上に、薄膜シリコンに形成されたLSIチップ12と、金属膜が蒸着されて形成されLSIチップ12に接続されたアンテナ13とが形成されている。アンテナ13に電磁波が受信されると電磁誘導により起電力が発生し、LSIチップ12がこの電力を供給されて動作し、内部に保持していたデータをアンテナ13を介して送信する。LSIチップ12が、送信回路のみならず受信回路及び信号処理回路を有する場合は、アンテナ13を介して信号を受信して処理を行い、その結果に応じて信号を送信することができる。このように、可撓性フィルム11に薄膜シリコンから成るLSIチップ12と蒸着された金属膜から成るアンテナ13が形成されていることで、変形が自由で多様な形状の商品に貼り付けることができ、コスト及び電力の低減にも寄与する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】可撓性フィルムと、

前記可撓性フィルム上に形成され、電磁波を受信するアンテナと、

前記可撓性フィルム上に搭載された薄膜シリコンに形成され、前記アンテナに前記電磁波が受信され電磁誘導により発生した電力を供給されて動作し、内部に保持しているデータを前記アンテナを介して送信する回路と、を備えることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】前記回路は、前記アンテナにより受信され 10 た前記電磁波を信号として与えられて所定の処理を行い、この処理の結果に基づいて内部に保持している前記データを前記アンテナを介して送信することを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】前記回路は、前記データを記憶する書き換え可能なメモリをさらに備えることを特徴とする請求項 1又は2記載の半導体装置。

【請求項4】前記回路は、前記薄膜シリコンにおいてボディが相互に電気的に分離されるように形成された複数のトランジスタを有し、各々のトランジスタにおけるボ 20 ディ電位はゲート電位と同一になるように、他のトランジスタのボディ電位とは独立して制御されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置であって、例えば物流システムにおける商品管理用のタグとして用いるのに好適な装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、通信技術の進歩及び物流関連ビジ 30 ことができなかった。 ネスの進展に伴い、無線で情報を送信する通信機能を備 【0009】さらに、 えたいわゆる無線タグを商品に取り付けて、商品の販売 とかなり高く、これを 管理や在庫管理を行うことが以下の文献1により提案さ ものに限られていた。 の無線タグを回収した

【0003】文献1: 月刊セミコンダクタワールド、1998年3月号、第22~33頁「電子商取引へFeRAMが99年に出陣、ファッション衣料品が携帯端末を持つ」

図16に、従来の無線タグの外観を示す。樹脂性ケース 141に、通信機能を有する回路が集積されたLSI (Large Scale Integrated circuit) チップ142と、 LSIチップ142に接続されたアンテナ145と、LSIチップ142が処理した内容を表示するLCD (Li quid Crystal Display) 表示装置143と、LSIチップ142に電源を供給する太陽電池144とが搭載されている。

【0004】例えば、小売店におけるレジスタから、当該無線タグが取り付けらている商品の分類、名称、売値等に関する属性データを問い合わせる信号が発信され、アンテナ145を介してLSIチップ142に受信され 50

る。LSIチップ142はバルクシリコン基板上に回路が形成されており、内蔵するメモリに記憶されている商品の属性データをLCD表示装置143に表示させ、さらにアンテナ145を介して属性データを示す信号をレジスタへ向けて送信する。

【0005】図17に、LSIチップ142に内蔵された回路の概略構成を示す。この回路は、RF(Radio Frequency)信号変復調部161と、信号/データ処理部152とを備えている。RF信号変復調部161はアンテナ145を介して信号を送受信するために必要な変復調等の処理を行うもので、変調回路162、復調回路163、アンテナドライバ164、R/Fアンプ165を有している。信号/データ処理部152は受信した信号に基づいて内蔵するデータを画像表示及び送信するために必要な処理を行い、中央処理装置(MPU)155、ROM/RAM部154、インタフェース(I/F)部153、入出力(I/O)部156を有している。

【0006】このように、従来の無線タグはバルクシリコン基板に形成されたLSIチップ142と、LSI142を駆動するための太陽電池144と、無線タグの処理の状況を作業者が目視確認するためのLCD表示装置143とを備えていた。

【0007】しかし、この無線タグは上述したような多くの機能を搭載するため、その大きさは8.5cm×5.75cmというようにかなり大きかった。

【0008】また、バルクシリコンに形成されたLSIチップ142等を搭載するためケースとして堅い樹脂性ケース141が用いられていた。このため、表面が平坦でかつ比較的な大きい商品にしか無線タグを取り付けることができなかった。

【0009】さらに、1個当たりの価格は約1000円とかなり高く、これを取り付ける商品は約1万円以上のものに限られていた。さらに、高価格ゆえ販売後にはこの無線タグを回収しなければならないという問題もあった。

【0010】上述の無線タグにおける大きく形が固定され価格が高いという問題のうち、大きさ及び価格の問題を若干解消したものが、以下の文献2により提案され図18に示された従来の他の無線タグである。

【0011】文献2: TRIGGER、1997年7 月号、第32~33頁「1枚100円以下を実現した小型非接触ラベル」

この無線タグは、機能を無線に絞り込むことで、表示部と電源とを内蔵しないものとなっている。さらにコストを低減するため、このタグはバルクシリコン基板上に形成した約3mm角のペアチップ172とアンテナ173とが透明樹脂171上に直接搭載されており、さらにアンテナ173を小さくするため2GH2帯の周波数で送受信が行われる。

【0012】この無線タグによれば、6cm×1cm×

1

30

0. 1 mmの大きさまで小型化が可能で、かつ価格を1 個当たり100円程度まで低減することができる。

【0013】しかし、この無線タグも形が固定されてお り、表面が平坦でかつ比較的な大きい商品にしか取り付 けることができなかった。また、依然としてタグとして は価格が高いため、回収が必要であった。さらに、内蔵 電池を備えていないため、文献1に示された無線タグと 比較すると、回路としての機能が大幅に限定されてい た。

【0014】また、文献2に開示された無線タグでは、 コスト低減のためパルクシリコン基板上にディジタル信 号を処理する信号/データ処理部と、アナログ信号を処 理するRF変復調部とを混載しなければならない。この 結果、信号/データ処理部が発生するノイズがRF変復 調部に影響し、誤動作を招くおそれがあった。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、従来の 無線タグにはタグ自身の形状が固定されており、柔軟性 がないため取り付け可能な商品が限定され、コストが高 く回収を必要とし、さらにーチップに混載されたディジ 20 タル回路が発生するノイズでアナログ回路が誤動作する という問題があった。

【0016】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの で、変形自在で任意の形状の商品に取り付けが可能で、 単価が十分に低減され使用後に回収する必要がなく、回 路の誤動作を防止することが可能な半導体装置を提供す ることを目的とする。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体装置は、 可撓性フィルムと、前記可撓性フィルム上に形成され、 電磁波を受信するアンテナと、前記可撓性フィルム上に 搭載された薄膜シリコンに形成され、前記アンテナに前 記電磁波が受信され電磁誘導により発生した電力を供給 されて動作し、内部に保持しているデータを前記アンテ ナを介して送信する回路とを備えることを特徴としてい

【0018】ここで前記回路は、前記アンテナにより受 信された前記電磁波を信号として与えられて所定の処理 を行い、この処理の結果に基づいて内部に保持している 前記データを前記アンテナを介して送信するものであっ 40 てもよい。

【0019】また前記回路は、前記データを記憶する書 き換え可能なメモリをさらに備えてもよい。

【0020】前記回路は、前記薄膜シリコンにおいてボ ディが相互に電気的に分離されるように形成された複数 のトランジスタを有し、各々のトランジスタにおけるボ ディ電位はゲート電位と同一になるように、他のトラン ジスタのボディ電位とは独立して制御されるものであっ てもよい。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態につ いて図面を参照して説明する。

【0022】本発明の第1の実施の形態による半導体装 置の外観を図1に示す。可撓性フィルム11の表面上 に、LSIチップ12とアンテナ13とが搭載されてい

【0023】可撓性フィルム11は、柔軟性のある樹脂 やゴム、紙等の材料から成り、平坦なシート形状を有す るものである。例えば、フィルム11としてバーコード 10 用のシールを用いてもよい。

【0024】LSIチップ12は、バルクシリコン基板 ではなく薄膜シリコンにLSIが形成され、大きさは例 えば約2mm角である。

【0025】アンテナ13は、可撓性フィルム11の表 面上に金属膜が蒸着されて形成され、LSIチップ12 に電気的に接続されている。また、本装置では送受信の ための信号としてGHz帯の周波数を有するものを扱う ことで、アンテナ13の長さが例えば全長約7cmとい うように極力短くなっている。また、アンテナ13が変 形しにくいように、矩形状の可撓性フィルム11の短辺 方向に沿って配置されている。

【0026】また、本装置は電池等の電源やLCD等の 画像表示装置を有していない。LSIチップ12は、ア ンテナ13に電磁波が受信されて電磁誘導によって発生 した電力を供給されて動作する。

【0027】このように、本実施の形態による半導体装 置は可撓性フィルム11に2mm角程度のLSIチップ 12とアンテナ13とが形成されているので、装置全体 に柔軟性があり、自在に変形可能である。また、可撓性 フィルム11の裏面側に接着剤を塗布したり接着シート を貼り付けることで、この半導体装置を多種多様なもの に自在に貼り付けることができる。例えば、図3 (a) に示された林檎41やバナナ43のような様々な形状の 商品に、本実施の形態による半導体装置を無線タグ4 2、44として貼り付けることができる。

【0028】図2に、LSIチップ12が搭載する回路 のプロック構成を示す。この回路は、RF信号変復調部 31と、信号/データ処理部21とを備えている。RF 信号変復調部31は、アンテナ13を介して信号を送受 信するために必要な変復調等の処理を行うもので、変調 回路32、復調回路33、アンテナドライバ34、R/ Fアンプ35を有している。信号/データ処理部21は 受信した信号に基づいて内蔵するデータをアンテナ13 を介して送信するために必要な処理を行うもので、MP U24、ROM/RAM部23、I/F部22、I/O 部25を有している。

【0029】このように、本実施の形態ではアンテナ1 3を介してRF信号変復調部31により信号を受信し、 受信した信号に基づいて信号/データ処理部21におい

50 てROM/RAM部23に格納された属性データ等のデ

ータを、RF信号変復調部31からアンテナ13を介して送信する。

【0030】しかし、このような回路構成を必ずしも備えている必要はない。例えば、受信機能や内蔵メモリ、MPUを備えていなくともよい。この場合には、アンテナ13に電磁波が受信されて電磁誘導により起電力が発生して回路が動作を開始し、これにより所定のデータを自動的に送信する。この場合のデータは、内蔵メモリの替わりにファームウェア化された状態で保持されたものを用いることができる。

【0031】次に、本実施の形態による半導体装置を製造する方法について図4~図9を用いて説明する。図4に示されたように、LSIチップを形成するための薄膜シリコンとして、シリコン基板51の表面上に埋め込み酸化膜52が形成されたSOI(Silicon On Insulator)基板を用いる。これは、コスト及び消費電力の低減化が可能であり、しかも後の工程で埋め込み酸化膜52上に薄膜シリコン53を形成することが容易だからである。ここで、例えばシリコン基板51の厚さは約500 μ m、埋め込み酸化膜52は $0.1~0.4 <math>\mu$ m、薄膜 20シリコン53は $0.1~1.0 <math>\mu$ mとしてもよい。

【0032】このような基板を用いて、図5~図9に示されるような工程を経てLSI素子とアンテナ13とを形成する。図5に示されたように、薄膜シリコン53の周辺部に、例えばLOCOS法を用いて分離層54を形成し、さらに薄膜シリコン53の内部にLSI素子として例えばNチャネル型MOSトランジスタのN+型拡散層55及び56を不純物の注入及び拡散により形成する。N+型拡散層55及び56が形成された薄膜シリコン53の表面上に、ゲート絶縁膜を介してゲート電極58を形成する。また、ゲート電極58が形成されていない領域には、絶縁膜57を形成する。さらに、N+型拡散層56とコンタクトをとった状態で、絶縁膜57上にアルミニウム等の金属をスパッタリングにより蒸着させて、アンテナ接続用金属配線59を形成する。

【0033】そして、図6に示されたように、絶縁膜57やアンテナ接続用金属配線59が形成された基板51の表面上に接着剤60を塗布する。これは、薄膜シリコン53及び埋め込み酸化膜52と、その下のシリコン基板51とを切り離すための準備として行う。

【0034】次に、図7に示されたように、接着剤60を介在させた状態でシリコン基板51の表面上にフィルム61を載せる。図8に示されたように、フィルム61が下部にくるように上下を反転させ、シリコン基板52を研磨していくことで切り離す。

【0035】このようにして得られたLSIチップ12 を、図9に示されたように上述の可撓性フィルム11の 表面上に接着剤等を用いて固定する。さらに、LSIチ ップ12の側面に露出したアンテナ接続用金属配線59 と電気的に接続されるように、アルミニウム等の金属を 50 スパッタリングにより可撓性フィルム11上に蒸着させて、アンテナ13を形成する。

【0036】ここで、本実施の形態における薄膜シリコンを用いたLSIチップ12と、従来の無線タグにおけるバルクシリコン基板を用いたLSIチップ142とにおける、それぞれのトランジスタの構造及びその製造工程について比較する。

【0037】従来のバルクシリコン基板を用いたLSIチップ142では、図10にその縦断面構造が示された 10 MOS型トランジスタと、図12に示された縦型バイポーラトランジスタとが、いわゆるバルクBiCMOS技術が用いられて形成されている。MOS型トランジスタは、バルクシリコン基板81の表面部分に、ソース、ドレインとしての不純物拡散層82、83と、ゲート電極84とを備えている。バイポーラトランジスタは、バルクシリコン基板81の表面部分において、シャロートレンチ04とディープトレンチ102及び103とによって素子分離された状態で、ベース105、エミッタ106、コレクタ107が形成されている。

【0038】本実施の形態における薄膜シリコンに形成されるMOSトランジスタは図11に示されるような構造を有し、横型バイポーラトランジスタは図13に示されるような構造を有している。MOSトランジスタは、埋め込み酸化膜52の下面側に薄膜シリコン53が位置し、この薄膜シリコン53にソース、ドレインとしてのN+型拡散層55、56が形成され、ゲート酸化膜を介してゲート電極58が形成されている。

【0039】横型バイポーラトランジスタは、埋め込み酸化膜52の下面側の薄膜トランジスタ53に、コレクタとしてのN+型拡散層112、ベースとしてのP型拡散層113、エミッタとしてのN+型拡散層114が形成され、それぞれの拡散層112~114上には電極115~117が形成されている。

【0040】本実施の形態ではバルクシリコンを用いずに薄型シリコンにトランジスタを形成するため、寄生容量が小さく高速化及び低消費電力化に寄与することができる。

【0041】さらに、図12より明らかなように、従来の無線タグにおけるバルクシリコンに形成される縦型バ40 イポーラトランジスタは、その構造が極めて複雑で多くの工程を必要とし、製造コストが高いという問題がある。

【0042】これに対し、本実施の形態において用いられる横型パイポーラトランジスタは、図13に示されるように構造が簡易であり、製造工程の数も縦型パイポーラトランジスタより少ない。例えば、LSIのデザインルールを $0.25\sim0.35\mu$ mとした場合、横型パイポーラトランジスタは約520で縦型パイポーラトランジスタは約370である。従って、本実施の形態によれば工程数を約2/3まで削減することができる。工程数

が減少すると歩留まりも向上するため、LSIチップの 総合コストで考えると従来よりも約1/2~1/4に低 減することが可能である。

【0043】また、LSIチップを搭載する基板のコストを考えた場合、従来の装置で用いていた透明樹脂よりも本実施の形態における可撓性フィルムの方が約1/2まで低減することができる。図18に示された従来の無線タグを約100円とすると、本実施の形態は約30円程度であり、約1/3まで低減することができる。よって、例えば単価が100円程度の安い商品にも本実施の10形態による装置を無線タグとして用いることが可能であり、しかも回収が不要であるので、適用可能な市場が大幅に拡がる。

【0044】さらに、本実施の形態によれば従来の無線タグよりも消費電力を低減する効果が得られる。図14に示されたように、薄膜シリコン53に形成された各々のトランジスタにおけるボディ122、123の間を、埋め込み酸化膜52に接続された絶縁膜124で電気的に分離するように構成することで、各々のボディ122、123の電位を独立して制御することができる。こ20れにより、各々のトランジスタ毎に、ゲート58aとボディ122とを電気的に接続し、同様にゲート58bとボディ123とを接続して動作させることができる。

【0045】例えば電源電圧として0.5 Vを用いた場合、図15に示されたように、トランジスタのボディ電圧はゲート電圧と同じ0.5 Vであり、閾値電圧がほぼ0 Vになる。よって、0.5 Vの低電源電圧によっても高速に動作させることができる。また、トランジスタがオフ状態にある場合、ボディ電位とゲート電位は共に0 Vとなり、閾値電圧が約0.2 Vに上昇してオフ時のリ30一ク電流を低減することができる。従来の無線タグは電源電圧として1.5~3.0 Vを選択しているが、本実施の形態によれば上述したような理由により消費電力を1~2 桁低減することが可能である。

【0046】ところで、本実施の形態ではコスト低減のため太陽電池等の電源を内蔵していない。このため、図2にROM/RAM部として示されたような内部メモリを用いてデータを送信するように構成する場合には、不揮発性記憶装置を用いる必要がある。例えば、より低電源電圧で動作可能なFerro RAMを用いてもよい。こ40こでFerro RAMは、強誘電体を用いてデータの保持を行うが、強誘電体部はトランジスタの形成後、トランジスタの上部に形成される。よって、本実施の形態のようにシリコン基板が最終的に削除される場合にも形成することが可能である。

【0047】内部メモリの容量は、LSIFップ12の面積を縮小するため $64\sim1$ Kビットというように最小 限に抑えることが望ましい。

【0048】また、内部メモリとして随時書き換え可能 クシリコン基板に飛なメモリを用いることで、第三者のデータ読み出しを防 50 を示した縦断面図。

ぐ暗号システムを導入した場合のセキュリティを向上させることができる。この場合のメモリとしては、上述した Ferro RAMの他に、E'PROMを用いることもできる。

【0049】暗号システムとして、従来の無線タグでは 標準的なDES (Data EncryptionStandard) を用いる 場合が多かった。本実施の形態では、このようなシステムを用いてもよいが、セキュリティ性をより高めるため に、書き換え可能なメモリを用いることで定期的にRF U部の暗号を再構成してもよい。

【0050】従来の無線タグでは、上述したようにバルクシリコン基板にアナログ回路とディジタル回路とを混載していたため、ディジタル回路が発生するノイズによりアナログ回路が誤動作する場合があった。これに対し、本実施の形態ではバルクシリコン基板を用いずに薄膜シリコンを用いて回路を形成しているため、ノイズによる誤動作を防止することができる。

[0051]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、可 撓性フィルムにアンテナ及び回路を形成しているため、 変形自在であらゆる形状の商品への貼り付けが可能であ り、またコストが低減されるため使用後の回収が不要で あると共に適用可能な市場が拡大され、さらにアンテナ に受信した電磁波により回路を駆動することで消費電力 の低減が可能である。また、回路が薄膜シリコンに形成 されているため、バルクシリコン基板を用いた場合と異 なり、回路が内部で発生したノイズにより誤動作するこ とが防止される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態による半導体装置の 外観を示した斜視図。

【図2】同半導体装置に含まれるLSIチップの内部構成を示したレイアウト図。

【図3】同半導体装置を商品に貼り付けた状態を示した説明図。

【図4】同半導体装置におけるLSIチップを形成する 薄膜シリコンの断面を示した縦断面図。

【図5】同薄膜シリコンを用いて素子を形成する場合の 一工程を示した縦断面図。

3 【図6】同薄膜シリコンを用いて素子を形成する場合の図5に続く一工程を示した縦断面図。

【図7】同薄膜シリコンを用いて素子を形成する場合の 図6に続く一工程を示した縦断面図。

【図8】同薄膜シリコンを用いて素子を形成する場合の図7に続く一工程を示した縦断面図。

【図9】図8に示されたLSIチップをフィルム上に搭載しアンテナを形成したときの断面を示した縦断面図。

【図10】従来の無線タグにおいて用いられていたバルクシリコン基板に形成されたMOSトランジスタの断面を示した縦断面図。

【図11】本発明の一実施の形態において用いられる薄膜シリコンに形成されたMOSトランジスタの断面を示した縦断面図。

【図12】従来の無線タグにおいて用いられていたバルクシリコン基板に形成されたバイポーラトランジスタの 断面を示した縦断面図。

【図13】本発明の一実施の形態において用いられる薄膜シリコンに形成されたバイポーラトランジスタの断面を示した縦断面図。

【図14】同実施の形態において用いられる薄膜シリコ 10 ンに形成され相互に分離された複数のMOSトランジス タの断面を示した縦断面図。

【図15】図14に示されたMOSトランジスタの閾値 電圧とボディ電圧との関係を示したグラフ。

【図16】従来の無線タグの外観を示した斜視図。

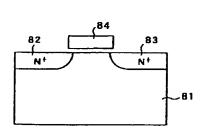
【図17】同無線タグに含まれるLSIチップの内部構成を示したレイアウト図。

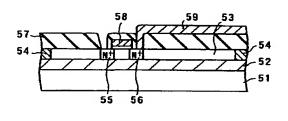
【図18】従来の他の無線タグの外観を示した斜視図。 【符号の説明】

- 11 可撓性フィルム
- 12 LSIチップ
- 13 アンテナ
- 21 信号/データ処理部
- 22 I/F部

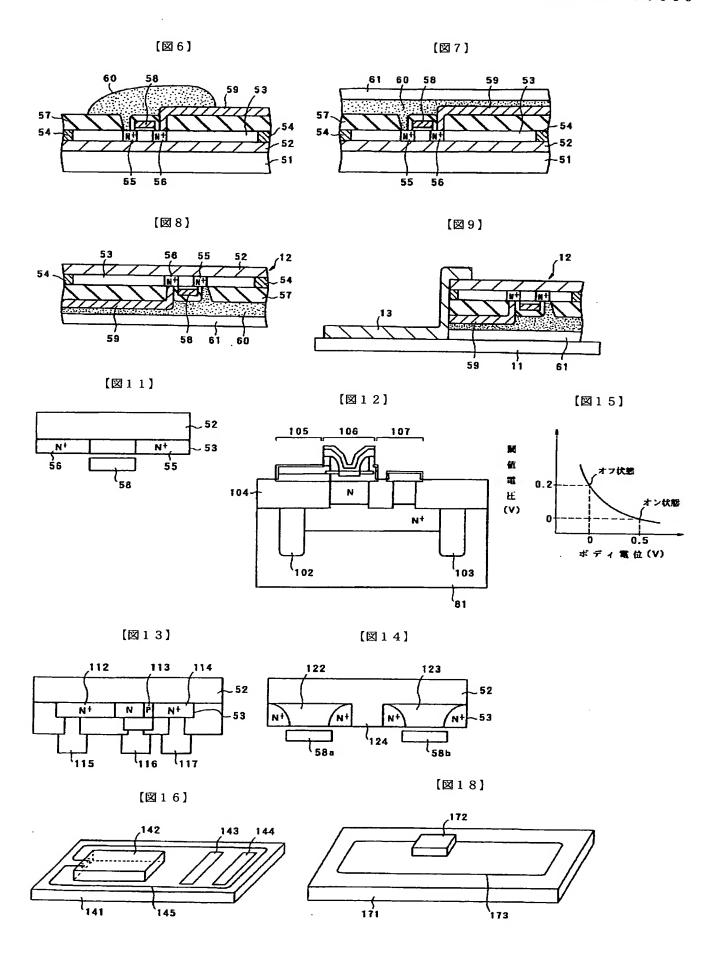
- 23 ROM/RAM部
- 24 MPU
- 25 1/0部
- 31 RF変復調部
- 32 変調回路
- 33 復調回路
- 34 アンテナドライバ
- 35 RFアンプ
- 41 林檎
- 43 パナナ
 - 42、44 無線タグ
 - 51 シリコン基板
 - 52 埋め込み酸化膜
 - 53 薄膜シリコン
 - 54 分離層
 - 55、56、112 N+ 拡散層
 - 57、124 絶縁膜
 - 58、58a、58b ゲート電極
 - 59 アンテナ接続用金属配線
- 20 60 接着剤
 - 61 フィルム
 - 115~117 電極
 - 122、123 ボディ



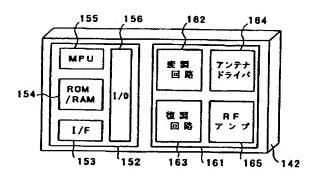




[図5]



【図17】



フロントページの続き

(72)発明者 亀 山 敦神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 吉 原 邦 夫 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会 社東芝研究開発センター内 F 夕一ム(参考) 5B035 AA00 AA05 AA11 BA03 BB09 BC00 CA01 CA23 5C084 AA03 AA08 BB04 BB21 BB31 CC34 DD07 DD87 GG01 GG52 GG74 5K012 AA05 AB05 AB18 AC08 AC10 AE13 BA03 BA07